

立即发布

D2S 首席产品官庞琳勇 Leo 博士被评为 SPIE Fellow

用以表彰庞博士在光学界的杰出成就和贡献，包括将曲线逆光刻技术 (ILT) 引入半导体光刻和光掩模行业。

加州圣何塞，2023 年 2 月 7 日 - D2S 是半导体制造业 GPU 加速解决方案的供应商，今天宣布 Dr. Linyong (Leo) Pang 庞琳勇博士，D2S 首席产品官和执行副总裁，已被 SPIE，国际光学和光子学协会，评为 Fellow。每年，SPIE Fellow 计划会在全球选出在光学，光子学和成像领域有重大科学和技术贡献的协会成员成为 Fellow。庞博士将在本月早些时候在圣何塞举行的 SPIE 先进光刻 + 样式化会议上正式接受这一荣誉。

庞博士最广为人知的是曲线逆光刻技术 (ILT，他命名的技术) 的代表人物，他将该技术引入了光刻和光掩模世界，并致力于推广该技术和生态系统，使其得到采用。ILT 现在是一项关键的光刻技术，已在生产尖端芯片的过程中使用，以提高工艺窗口和良率。

在 D2S 公司，庞博士领导了该行业唯一的 GPU 加速掩模数据准备 (MDP) 和掩模过程校正 (MPC) 解决方案的开发和采用，以及新一代 ILT 的开发和采用，该产品是行业第一个 GPU 加速、全芯片、无缝、曲线形 ILT 产品。在加入 D2S 公司之前，他创立并担任过 Luminescent 公司计算光刻部门的总经理和资深副总裁 (计算光刻业务于 2012 年被 Synopsys 收购)，以及 Luminescent 的计算测量与检测部门的总经理和资深副总裁 (于 2014 年被 KLA-Tencor 收购)。他在 EDA 和半导体行业的开创性工作始于 20 多年前，当时他在 Numerical Technologies 公司发明了该公司的 i-Virtual Stepper 系统。

庞博士对 SPIE 做出了重要贡献。他曾担任过 SPIE 光掩模技术会议的组委会成员，SPIE 光掩模技术会议和光掩模日本会议的会议主席和部门主席，微米纳米光刻、材料与测量学杂志 (JM3) 的副编辑，以及 JM3 的深度学习专刊和即将发布的曲线形掩模专刊的嘉宾编辑。此外，他自 2001 年以来几乎在每一届 SPIE 先进光刻技术会议和光掩模技术会议上都有发表论文，其中包括与美光合作撰写的关于 D2S GPU 加速曲线 ILT 技术的论文，该论文获得 2019 年光掩模技术和 EUV 光刻技术会议最佳演讲奖 (第二名)。他于 2022 年当选 SPIE 高级成员。

庞博士还为光学和半导体界做出了重大贡献，除了 SPIE 之外。十多年来他一直担任由 SEMI 和 IEEE 组织的中国国际半导体技术会议 (CSTIC) 的光刻学术研讨会的共同主席和主席。他还曾担任过 Lithography Workshop 的会议主席和计算光刻分会的主席。

迄今为止，庞博士已获得 38 项发明专利、27 项待审专利，发表了 85 篇论文。庞博士毕业于美国斯坦福大学，获机械工程博士学位和计算机科学硕士学位。

D2S CEO Aki Fujimura 表示：“我们对 Leo 获得 SPIE 社区的这一荣誉和认可表示热烈的祝贺。他一直是 SPIE 的出色贡献者。他始终在思考如何将社区中的人聚集在一起合作，不仅是为了不断提高业界的最高技术水平，而且是为了建立整个生态，从而在整个行业中建立更强紧密的联系。”

有关 SPIE Fellow 项目的更多信息，请访问 <https://spie.org/membership/member-recognition/spie-fellows/>。

D2S 公司简介：

D2S 是为半导体制造业提供用 GPU 加速技术解决办法的供应商。本公司为尖端半导体仪器合作伙伴提供可定制的模拟技术。D2S 的 TrueMask® 技术，应用其计算设计平台 CDP，使得利用复杂形状的先进光罩设计成为可能，并能在实际限定时间内刻写完毕，以确保超好的晶圆质量和成本节省。D2S 是 the eBeam Initiative（电子束倡议团体）的经营主办者和电子制造深度学习中心 (CDLe) 的创建成员。公司成立于 2007，总部设于加州圣荷西。要获得更多信息，请查阅：www.design2silicon.com。

D2S, the D2S logo 和 TrueMask 是 D2S 公司的注册商标。

经办代理:

David Moreno (大卫 穆锐农)

Principal

Open Sky Communications

电话: +1.415.519.3915

电邮: dmoreno@openskypr.com